

2. Камышанченко Н.В., Колпаков А.Я., Никитин В.М., Воеводин В.И., Неклюдов И.М. Влияние радиационных дефектов на процессы формирования углеродных алмазоподобных покрытий: Материалы XIV Междунар. конф. по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению (12 – 17 июня 2000 г., г. Алушта, Крым).

3. V.N.Inkin, G.G.Kirpilenko, A.J.Kolpakov, Inter-

nal stress in ta-C films deposited by pulse arc discharge method // Diamond and Related materials, 10 (2001) 1103-1108.

4 .V.P.Goncharenko, A.J.Kolpakov, A.I.Maslov, Method of forming diamond-like carbon coating in vacuum // International patent, WO 98/54376, 3 December 1998.

УДК 621.793.621.941.0257

ПЕРЕНОС МАССЫ ПРИ ОСАЖДЕНИИ МОЛИБДЕНОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛАЗМЫ ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА

В.А.Белоус, В.М.Лунев, В.С.Павлов

г. Харьков, ННЦ "Харьковский физико-технический институт"

Проведены исследования переноса массы испаряемого вещества в системе катод-подложка при осаждении молибденовых покрытий из плазмы вакуумного дугового разряда, генерируемой источником с магнитным удержанием катодного пятна на рабочей поверхности катода. Установлено, что на внутренней поверхности шарового сегмента, расположенного над плоскостью катода, количество осаждаемого материала при телесных углах $\leq \pi$ ср практически не зависит от радиуса сегмента в интервале от 6,5 до 35,5 см. При телесных углах $> \pi$ ср коэффициент переноса массы снижается (от ~66 до ~46% при $\Omega=1,5 \pi$ ср) с изменением расстояния от 6,5 до 35,5 см, что связано, вероятно, с отражением «капель».

Тугоплавкие металлы, такие как, например, молибден, вольфрам, и их сплавы являются весьма перспективными для изготовления изделий новой техники, работающих при высоких температурах. Они могут быть получены как традиционными методами [1], так и методами испарения и конденсации в вакууме. В этом случае одной из важных задач является максимальное использование испаряемого материала, поскольку это один из основных показателей экономической целесообразности применения метода.

Известно, что потоки вещества, генерируемые вакуумно-дуговым разрядом, являются неоднородными по составу [2, 3]. Основная часть испаряемой массы приходится на ионы и «капли».

Для оценки практической реализации процесса получения изделий путем осаждения потока испаряемого вещества на подложку представлялось нецелесообразным определить коэффициент переноса молибдена с катода на заготовку детали в зависимости от расстояния катод-подложка, угловой координаты, а также оценить вклад в покрытие ионной и капельной составляющей.

Эксперименты по массопереносу проводились на установке типа «Булат» [4]. В качестве подложек использовались образцы из стали 3 размером 10мм x 15 мм с исходной шероховатостью поверхности $R_a \sim 0,1$ мкм. Образцы располагались на подложкодержателях в виде дуг радиусами 6,5; 11; 20 и 35,5 см с центром, совпадающим с центром рабочей поверхности катода. Осаджению покрытий предшествовала очистка при отрицательном потенциале подложки ~ 1 кэВ. Во время осаждения покрытий потенциал подложки составлял 20 В. В качестве испаряемого материала использовался молибден вакуумной плавки. Ток дуги составлял 150 А. Время осаждения – 30 мин. Масса сконденсированного материала и потери массы катода определялись весовым методом. Для оценки вклада «капель» в перенос массы измерялась шероховатость поверхности покрытий при помощи профилометра типа АП модель 283.

Определялась масса вещества, сконденсированного в единицу времени на поверхности шарового сегмента, в зависимости от

телесного угла Ω , под которым она видна из центра катода. С этой целью поверхность сегмента разделялась на пояса, параллельные плоскости катода. Долю вещества из испаряемой массы (коэффициент массопереноса), осажденную на части поверхности сегмента, определяли суммированием по поясам и рассчитывали по формуле

$$\frac{\Delta M}{\Delta m_k} = \frac{1}{\Delta m_k} \sum_{\Omega=0}^{2\pi} 2\pi R H(\Omega) h(\Omega) \rho,$$

где $2\pi R H(\Omega)$ – площадь поверхности шарового пояса;

$H(\Omega)$ – его высота;

R – радиус;

$h(\Omega)$ – толщина покрытия на Ω -поясе;

ΔM – расчетное количество материала, сконденсированного в единицу времени на поверхности сегмента;

Δm_k – убыль массы катода за то же время и ρ – плотность молибдена.

На рис. 1 представлены угловые распределения величины прироста массы конденсируемого молибдена на единице поверхности подложки по отношению к убытке массы катода с единицы его рабочей поверхности за одно и то же время.

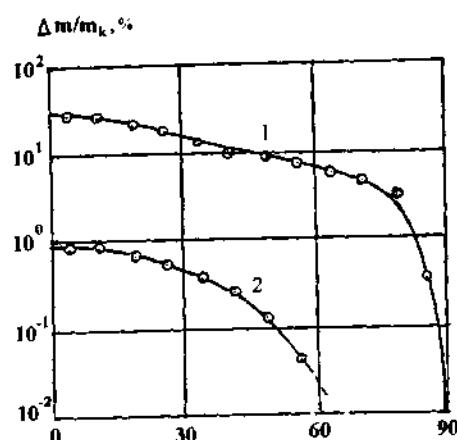


Рис.1. Угловые распределения величины переноса массы молибдена для расстояний катод-подложка: $R=6,5$ (1) и $35,5$ (2) см.

Из приведенных данных следует, что максимальная скорость наблюдается в направлении вертикали от поверхности катода и при сильном отклонении от нее падает практически до нуля. Это обусловлено большой неоднородностью пространственного распределения плотности плазмы в потоке, генерируемом катодными пятнами [5].

Из рисунка следует также, что с увеличением расстояния от катода скорость переноса массы значительно снижается.

Зависимость коэффициента переноса массы на поверхность сферического сегмента от величины телесного угла Ω представлена в табл.1 для расстояний от катода $R=6,5$ и $35,5$ см.

Таблица 1
Перенос массы испаряемого молибдена
на поверхность сегмента

Ω , ср	$\Delta M/\Delta m_k$, %	
	$R=6,5$ см	$R=35,5$ см
0	0	0
0,25π	8	8
0,5π	20	21
0,75π	35	33
1π	47	42
1,25π	57	45
1,5π	66	46
1,75π	73	-
2π	75	-

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что с увеличением расстояния от катода коэффициент переноса массы на поверхность сегмента также снижается, причем снижение его становится более существенным в области больших телесных углов. Так, при $\Omega = \pi$ коэффициент переноса при изменении R от 6,5 до 35,5 см уменьшается на ~5% (от 47 до 42%), в то время как при $\Omega=1,5$ πср – на ~20% (от 66 до 46%). При $\Omega=2\pi$ (полусфера) и $R = 6,5$ см перенос массы равен 75% (см. табл.). Значение $\Delta M/\Delta m_k < 100\%$ может иметь место, на наш взгляд, при частичном распылении формируемого конденсата ионами осаждаемого металла и отражением «капель».

Существенное уменьшение переноса вещества, наблюдаемое с увеличением расстояния от катода в области больших телесных углов, связано, по-видимому, с доминирующей ролью отражения «капель» молибдена. Подтверждением этого являются результаты измерения шероховатости (рис. 2), которая, как известно, [6], зависит от размера и количества «капель» в покрытии. Действительно, шероховатость молибденовых покрытий, осажденных в направлении малых углов, к поверхности катода выше ($\alpha=75^\circ$ в ~2 раза), нежели для об-

разцов, расположенных перпендикулярно к оси катода. Эти данные согласуются с результатами работы [7], где показано, что основное количество капель молибдена распространяется в этом же направлении.

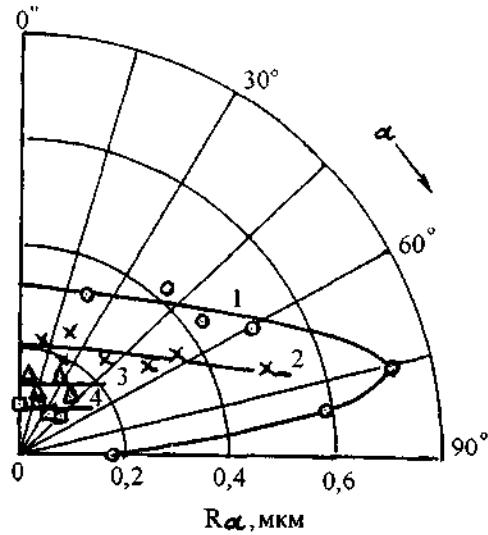


Рис.2. Угловые распределения шероховатости молибденовых покрытий, осажденных при $R = 6,5(1); 11(2); 20(3)$ и $35,5$ см(4).

По величине изменения коэффициента переноса массы на поверхность сегмента с удалением ее от катода в области больших телесных углов можно предположить, что на долю «капель» приходится не менее 20% сконденсированного молибдена (при $\Omega = 1,5\pi$ ср).

Выводы. 1. Показано, что при осаждении молибдена из плазмы вакуумного дугово-

го разряда основное количество материала (~60%) конденсируется в интервале телесных углов $\leq \Omega = 1,5$ ср при расстоянии катод-подложка 6,5 см.

2. С удалением от катода на расстояние от 6,5 до 35,5 см массоперенос значительно снижается (в ~1,4 раза при $\Omega = 1,5 \pi$ ср), что связано с отражением капель.

Библиографический список

1. Савицкий Е.М., Бурханов Г.С. Металловедение тугоплавких и редких металлов. – М.: Наука, 1971.– 240с.
2. Аксенов И.И., Коновалов И.И. и др. Исследование капельной фазы эрозии катода стационарной вакуумной дуги // ЖТФ. – 1984. – Т.54. – Вып.8. – С.1530-1534.
3. Егоров В.Д., Клубович В.В., Литвинов А.А. Фазовый состав плазмы, генерируемой стационарной вакуумной дугой // Физика и химия обработки материалов.– 1992.– Вып.6.– С.69-75.
4. Саблев Л.П., Долотов Ю.И., Ступак Р.И., Осипов В.А. Электродуговой испаритель металлов с магнитным удержанием катодного пятна // ПТЭ.– 1976.– Вып.4.– С.247-249.
5. Лунев В.М., Падалка В.Г., Хороших В.М. Исследование некоторых характеристик плазмы вакуумной металлической дуги // ЖТФ.– 1977.– Т.47.– Вып.7.– С. 1491-1495.
6. Белоус В.А., Лунев В.М. Шероховатость титановых покрытий, получаемых из несепарированных потоков плазмы вакуумного дугового разряда: Сб. ВАНТ.– Харьков.– 1998.– Вып.5(71).– С.89-90.
7. Хороших В.М. Об эрозии катода стационарной вакуумной дуги в капельной фазе // Труды XIV Междунар. конф. по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению: Сб. ВАНТ.– Алушта, 2000.– С.238-239.

УДК 533.9

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ НИТРИДОВ ТИТАНА

В.В.Кунченко, А.А.Андреев, Г.Н.Картмазов

г.Харьков, ННЦ "Харьковский физико-технический институт"

В настоящей работе представлены результаты комплексных исследований взаимосвязей состава, структуры, условий осаждения вакуумно-дуговых покрытий на основе нитридов Ti с их эрозионными свойствами. Исследования проведены на образцах из сплавов титана BT-6 и сплава BT-8 в исход-

ном состоянии ($HRC = 40\dots42$, $H_05 = 3,2 \cdot 10^3$ МПа) и отожженных в вакууме при 920°C , 2 часа и 590°C – 2,5 часа ($HRC = 36\dots38$, $H_05 = 2,8 \cdot 10^3$ МПа) ОТ-4 и на образцах из сталей 12Х18Н10Т, X18Н9Т.

Нанесение покрытий производилось на установке типа "Булат". Толщина покрытий